

「第2回CECC-JEITA知的財産保護会議」の概要報告

はじめに

当協会と中国電子商会（China Electronics Chamber of Commerce：CECC）は、2月23日（木）、中国／北京市において、「第2回CECC-JEITA知的財産保護会議」を開催しました。

今回は、平成16年11月の第1回会議（北京市）に続く2回目の開催で、電子情報技術産業に係わる知的財産の適切な保護（模倣品対策等）のため、日中の業界が意見・情報交換を行いました。

経緯

中国における模倣品対策等の知的財産の適切な保護は、わが国の電子情報産業にとっても大きな課題です。このため、わが国では、官民合同かつ業界横断的な組織である「国際知的財産保護フォーラム」を中心に様々な取り組みがなされており、数次のミッションを中国に派遣し、中国政府関係機関に要請を伝えるとともに意見交換を行ってきたところで、JEITAもこの中心的なメンバーとして大きな貢献をしてきました。

また、電子情報技術産業に係わる知的財産保護問題に関して、日中の業界が協調して取り組もうと実施したCECC-JEITAの第1回会議（平成16年11月）では、日中双方の電子・電機業界の知財保護の必要性に対する認識を共有して連携の基礎が確立されました。その後1年間、双方に設置した窓口を通じて、日中の知財保護に関する情報交換を行ってきました。

開催概要

日時：2006年2月23日（木）9：00～17：40

場所：北京新世紀日航飯店

参加者：83名（日本側40名、中国側43名）

○日本側参加企業／団体（順不同）

主催者：（社）電子情報技術産業協会

参加企業：沖データ、オリンパス、キヤノン、ケンウッド、三洋電機、シャープ、セイコーエプソン、ソニー、東芝、日本電気、パイオニア、日立製作所、富士通、船井電機、松下電器産業

オブザーバ：経済産業省商務情報政策局、カメラ映像機器工業会、電池工業会、日本貿易振興機構（JETRO）

○中国側参加企業／団体（順不同）

参加企業：華為技術（Huawei Technologies）、清華同方（Tsinghua Tongfang）、北京華旗資訊數碼科技（Beijing Huaqi Information Digital Technology）、京東方科技集團（BOE Technology Group）、漢王科技股份（Hanwang Science & Technology）、首鋼日電電子（Shougang NEC Electronics）、飛利浦（中國）投資（Philips（China）Investment）、摩托羅拉（中國）（Motorola（China）Electronics）、北京旅之星業新技術（Beijing Travel Star Hi-tech）、北京正品科技（Beijing True Product Technology）、北京海龍資產經營集團（Beijing Hilon Asset Management Group）、Thomson 寬帶研發（北京）（Thomson Broadband R&D（Beijing））、大唐電信科技（Datang Telecom Technology）、天津通信廣播集團（Tianjin Communication & Broadcasting Group）、普



写真1. 開会の挨拶をする金子専務理事



写真2. 日本側の参加メンバー

(社) 電子情報技術産業協会 知的財産保護専門委員会 委員長
齋藤 憲道
(松下電器産業株式会社 法務本部 理事)

天信息技术研究院 (Potevio Institute of Technology)、威盛电子(中国) (VIA Technologies (China))、北京大华电子集团 (Beijing Dahua Electronic Group)、长虹朝华信息产品 (Changhong Zhaohua Information Product)

オブザーバ：中国国家質量監督檢驗檢疫総局、中国国家知識産権局、中国国際貿易促進委員会 (CCPIT)、中国化学与物理电源行业协会 (China Industrial Association of Power Sources)

議事内容

今回の第2回会議では、日中双方から電子情報産業に関する知的財産保護、模倣品対策に関する施策の動向、企業の取り組み状況等の紹介があり、活発な意見交換が行われました。

中国側からは、政府代表として国家質量監督檢驗檢疫総局 (AQSIQ) より、中国の知財保護の現状；政府を挙げての知財保護の取組みが紹介されたほか、国家知識産権局 (SIPO) より、企業における知財権保護の重要性が指摘されました。

中国企業からは、知的財産権の重要性を認識し、経営の重要戦略と位置付けて国際競争力を確保している例、また日本企業と同様のブランド侵害被害事例とその具体的な対応策が紹介されました。

これに対し日本側は、経済産業省から、知的財産立国を目指した日本政府の取組みを紹介し、JEITAから、各企業の被害事例や対応策、これらに関連するJEITAの活動などを紹介しました。さらに、オブザーバとし



写真3. 中国側のプレゼンテーションの様相

て参加したカメラ映像機器工業会、並びに電池工業会からもそれぞれ各自の取組みを紹介をするなど、双方で質疑応答を行い、理解を深めました。

成果

今回の会議において、JEITAとCECCは下記の項目について合意しました。

1. 1年後をめどに次回会議を日本で開催する。
2. 今後さらに次の項目について、知財保護に関する交流、連携を強化していく。

- ① 知的財産保護に関する情報の交換
- ② 知的財産保護に関する実態調査
- ③ 両国政府に対する連携した働きかけ
- ④ 知的財産保護に係る啓発活動

3. 共同調査を実施することとし、その推進のために双方に推進責任者を置く。

前回会議からの進展としては、今回の会議において、模倣品による被害の実態やその影響についての現状把握を行うため、日中双方で共同調査実施を合意した点が挙げられます。双方の推進責任者を確認し、今後、実施に向け、早期に具体的な検討を行うこととしています。

最後に

第2回会議の今回、中国の政府・企業とも、知的財産保護を重視し、その取組みが一層進展したことを強く感じました。

特に、中国企業から権利侵害に対する具体的な対応策が紹介された点、知的財産保護の分野においては日本企業と同じ立場にある中国企業の存在を改めて確認できて心強く感じると同時に、技術をコアにして権利取得を最重要経営方針とする企業の事例発表からは、中国において真の国際競争力を持つ企業が出現していることを認識した次第です。

今回の会議を契機に、日中両国業界が意見・情報交換を通じてさらに交流を深め、知的財産に関わる問題の解決に向け、さらに大きく前進するように参ります。